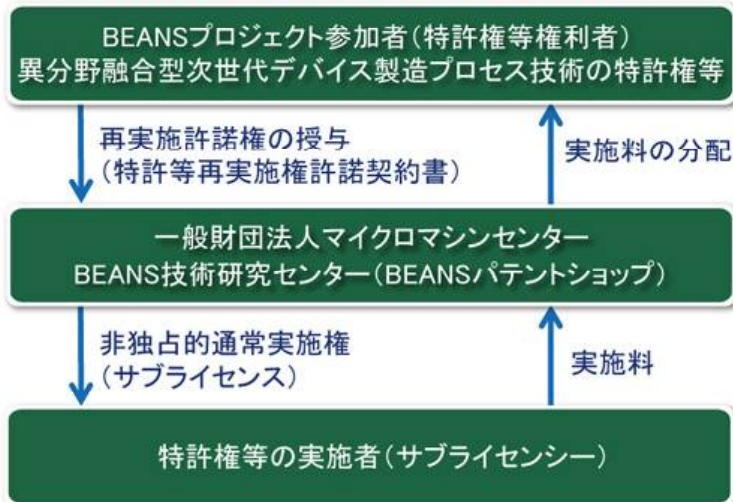


BEANSパテントショップで特許ライセンスを取得

BEANSプロジェクト成果である特許権等(公開前特許出願を含む)の利用を希望する事業者の方は、BEANSパテントショップ(BEANS技術研究センター)を通じて様々な特許権等の再実施権(サブライセンス)を受けることができます。

● BEANSパテントショップの仕組み



● BEANSパテントショップのメリット

▶ ワンストップライセンス

個々の特許権等権利者と複数のライセンス契約をしなくてはならない手間を省くことができます。

▶ バックグラウンドIPについても実施許諾

実施ご希望のBEANS特許権等の他に、BEANS特許権等権利者が保有するBEANS特許権等と利用関係にある特許(バックグラウンドIP)についても、特許権等権利者との協議により、実施許諾します。

▶ 実施料の優遇措置

中小・ベンチャー企業へは、低廉対価で実施許諾をします。(産業技術力強化法16条の2による措置)
IPパッケージに含まれる特許等の数により、経常実施料の実施料率を軽減します。
BEANSプロジェクト参加者には実施料率を軽減します。

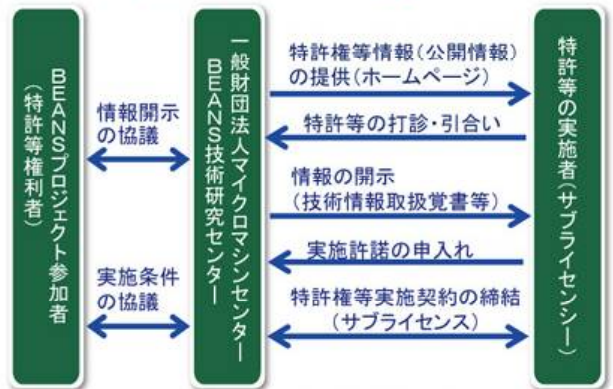
● BEANSプロジェクト参加者(特許権等権利者)

プロセス技術群	BEANS特許等の権利者
バイオ融合プロセス	東京大学、テルモ(株)、オリンパス(株)、三菱化学メディエンス(株)
有機材料融合プロセス	九州大学、パナソニック(株)、リンテック(株)、大電(株)
3次元ナノ構造形成プロセス	東京大学、富士電機(株)、(株)デンソー、オムロン(株)、(株)フジクラ、セイコーインスツル(株)、(株)東芝、パナソニック(株)、理化学研究所
マイクロ・ナノ構造大面積・連続製造プロセス	産業技術総合研究所、三菱電機(株)、古河電気工業(株)、東芝機械(株)、福井県工業技術センター
高機能センサネットワークと低環境負荷型プロセス	産業技術総合研究所、セイコーインスツル(株)、(株)デンソー、(株)アルバック、(株)堀場製作所、立命館大学
モデリングシミュレーション	みずほ情報総研(株)

● サブライセンスの内容

- **実施対象者**
日本国内で実施する事業者
- **実施権の内容**
非独占的通常実施権
(専用実施権、独占的通常実施権は不可)
- **実施料**
・ [一時金 + 経常実施料] で構成
・ 実施料の額は、協議のうえ決定
- **パッケージ・ライセンス方式**
プロセス技術群の特許権等の中から、実施を希望する事業者の実施目的に応じて複数の特許等を選択し、それらを“IPパッケージ”としてライセンスする方式。

● サブライセンスの流れ



- (注1) 特許権等の実施を希望する事業者から特許権等情報の打診引き合いがあった時は、技術情報取扱に関する覚書等の秘密保持契約書を締結したうえで開示します。
(注2) 実施条件の協議は、特許権等の実施者、特許権等権利者、及びBEANS技術研究センターの三者協議とします。

BEANSとは?

BEANS(Bio Electro-mechanical Autonomous Nano Systems)は、MEMS技術とナノ・バイオ技術が融合し、自律的に機能する異分野融合型デバイスの総称です。
BEANSプロジェクト(異分野融合型次世代デバイス製造プロセス技術開発プロジェクト)は、経済産業省の主導のもと、NEDO技術開発機構から受託を受け、技術研究組合BEANS研究所が中心となり関係機関・関係企業を結集して、産学連携の体制で実施しました。
◆プロジェクト期間:平成20年度~24年度(5年間)
◆参画機関:企業・大学・研究所・その他団体等が多数参加

問い合わせ先

一般財団法人マイクロマシンセンター BEANS技術研究センター
〒101-0026 東京都千代田区神田佐久間河岸67 MBR99ビル6階
電話 03-5835-1870 Fax 03-5835-1870
Email beans_office@mmc.or.jp
URL <http://beans.la.coocan.jp/patent/>



BEANSパテントショップ

<http://beans.la.coocan.jp/patent/>

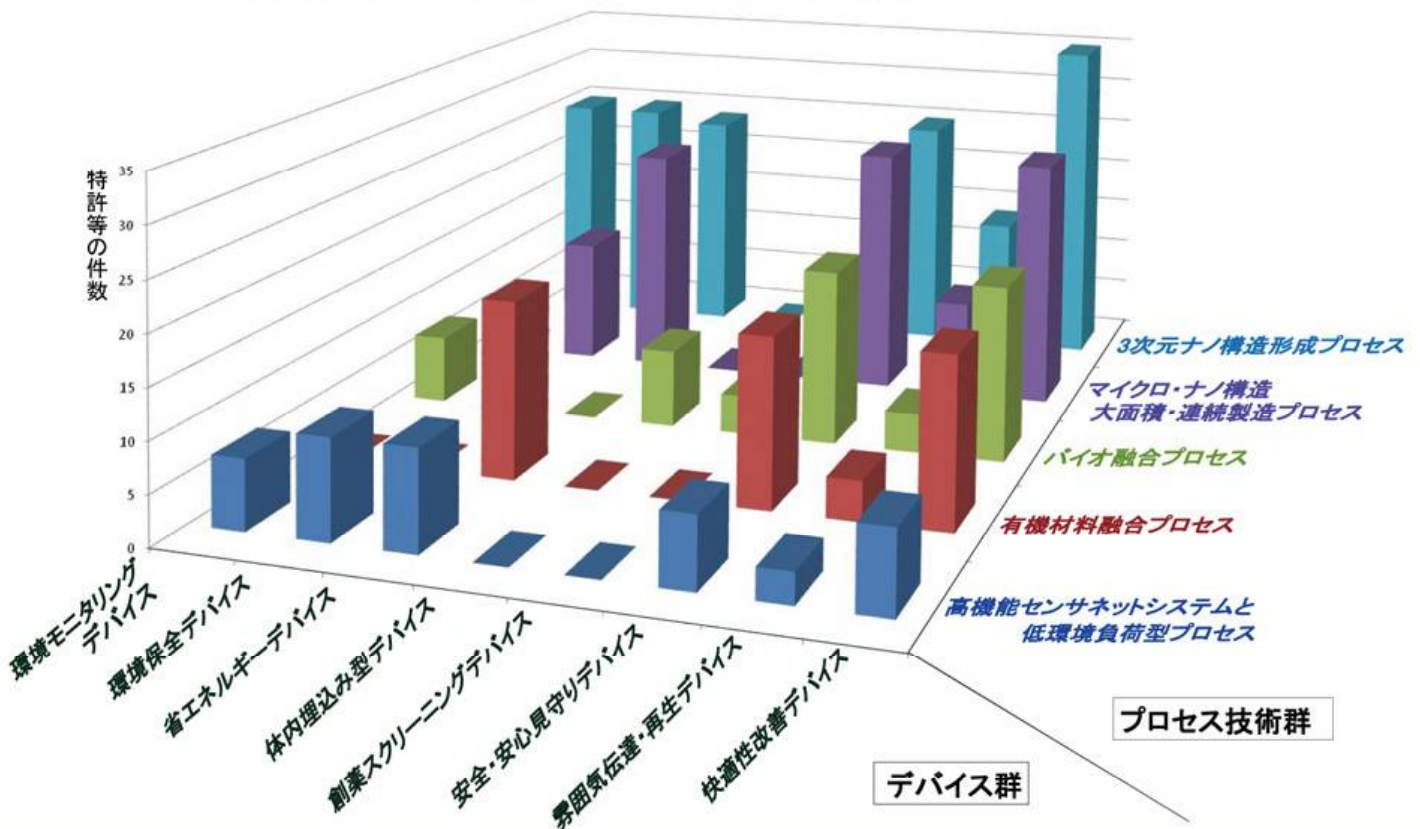
異分野融合プロセスで生み出すもの

- 想定デバイス
- 応用可能デバイス

デバイス群 プロセス群		環境・エネルギー			医療・福祉			安心・安全・快適		
		環境 モニタリング デバイス	環境保全 デバイス	省エネルギー デバイス	体内埋込 デバイス	創薬 スクリーニング デバイス	健康 モニタリング デバイス	安心・安全 見守りセンサ	雰囲気 伝送・再生 デバイス	快適性 改善 デバイス
バイオ 融合プロセス	バイオ・ナノ界面融合	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	バイオ高次構造形成	●	●	●	●	●	●	●	●	●
有機材料 融合プロセス	有機・ナノ界面融合	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	有機高次構造形成	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3次元 ナノ構造 形成プロセス	超低損傷・高密度	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	選択的機能性 ナノ構造修飾	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	超臨界流体を用いた 高均一製膜	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	宇宙適用 3次元ナノ構造形成	●	●	●	●	●	●	●	●	●
マイクロ・ ナノ構造 大面積・連続 製造プロセス	非真空高品位 ナノ機能膜大面積形成	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	繊維状基材 連続微細加工・集積化	●	●	●	●	●	●	●	●	●
モデリング シミュレーション		●	●	●	●	●	●	●	●	●

異分野融合プロセスの
フラットフォーム化で
革新的デバイスを創出

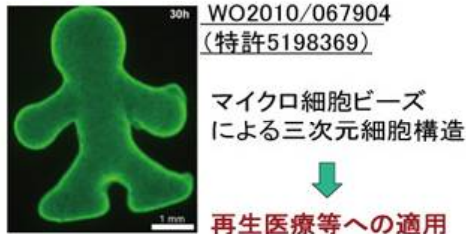
BEANS 特許等の適用デバイス事例



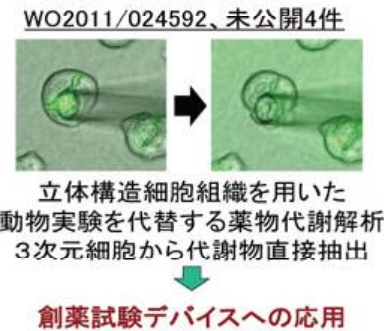
BEANS 特許等で生み出すもの(例)

バイオ融合プロセス技術

●3次元ヘテロ組織構造作成



●細胞立体構造形成



●血糖値の連続測定

特開2011-001468、特開2011-001469
特開2011-190403、特開2012-092326
未公開2件

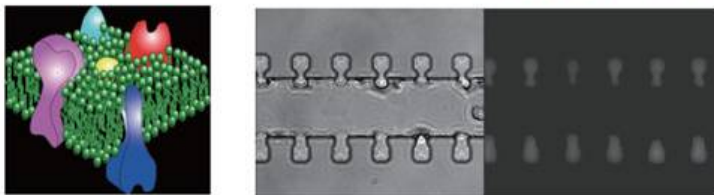


●脂質二重膜の長期安定形成

特許5198369、特開2012-205536、特開2012-205537、未公開3件

マイクロ流路デバイス内で細胞を構成
する脂質二重膜を人工的に形成

癌マーカー等を検出する
次世代センサー等への適用

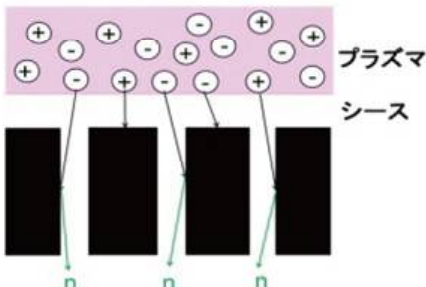


有機材料融合プロセス技術

●有機EL

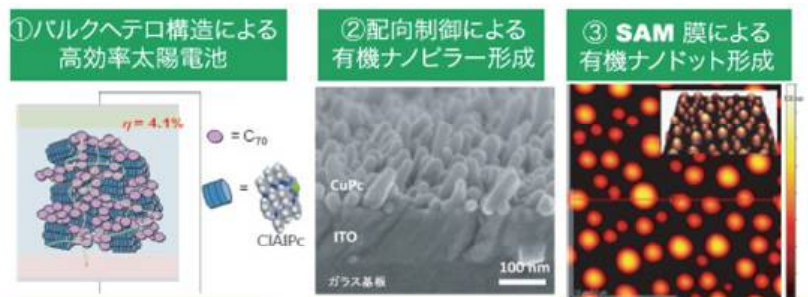
特開2010-228066、特開2011-064813、
WO2012/121189(特許5128728)、
WO2012/132884(JP開2012-209151)、
未公開1件

- ・中性粒子ビーム
- ・超低損傷・平滑エッチングが可能



●有機太陽電池

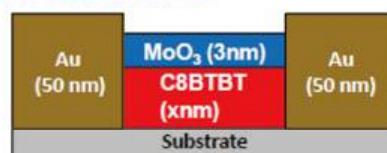
特開2010-232480、特開2010-232479、特開2011-236299、
特開2011-114215、特開2013-041983



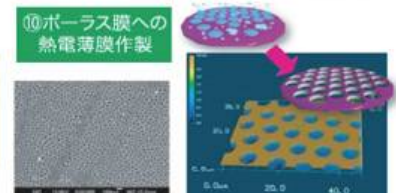
●熱電変換素子 (有機/無機)

特開2011-105780、特開2012-174813、特開2013-98422、未公開1件

C8-BTBT層の最適化

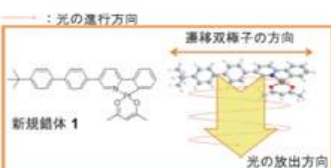


x: 10, 15, 18, 20, 25, 35 nm
MoO₃は膜厚依存実験により最適化



●複合構造

特開2011-118172
光増感剤、光制限素子



BEANS 特許等で生み出すもの(例)

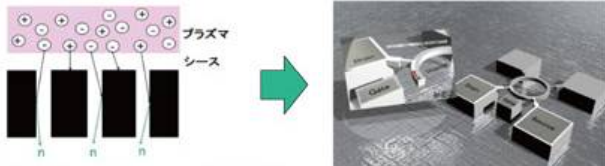
3次元ナノ構造形成プロセス技術

削る

(低消費電力高周波バンドパスフィルタ)

(中性粒子ビームエッチング)

特開2011-183539、未公開1件

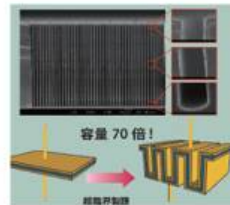


超低損傷・平滑エッチングが可能

成膜

(どんな凹凸も均一成膜)

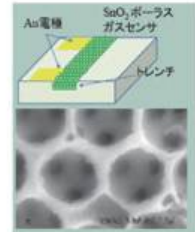
特開2011-111676、
特開2012-144387



並べる

(微粒子配列)

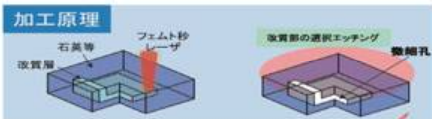
特開2011-056626、未公開3件



貫く

(フェムト秒レーザーでの3次元ナノ構造形成)

WO2011/096353、WO2011/096356、WO2012/008577、
WO2012/043726、WO2012/070490、WO2012/108316、
WO2012/161317、WO2013/002339、WO2013/31912、
未公開5件

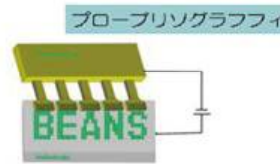


ナノオーダーの開口幅を有する3次元微細構造

描く

(耐久性・コストに優れる)

特許5007383、特許5044685
未公開2件

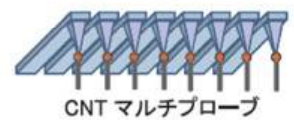


付ける

(異種材料間のプロセス)

特開2013-019779、未公開7件

機能性ナノ分子
(CNT、ペプチド等)の活用



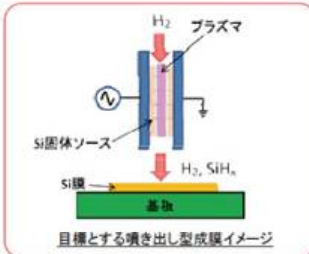
マイクロ・ナノ構造大面積連続製造プロセス技術

大面積形成

(大気圧プラズマ)

WO2011/033849、
特開2012-019024、
特開2012-241235
WO2012/101891、
未公開6件

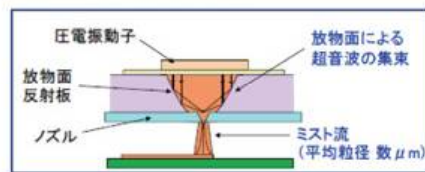
・特殊ガスを用いないSi成膜
・大気圧(700Torr)での成膜



(ミストジェット)

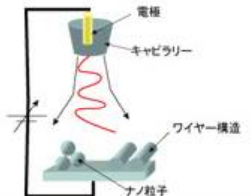
特開2011-011491、特開2011-111664

インクジェット技術と異なり、超音波エネルギーの利用により、平均粒径数 μm のミストを連続的に吐出可能



(エレクトロスプレー法によるナノ構造制御)

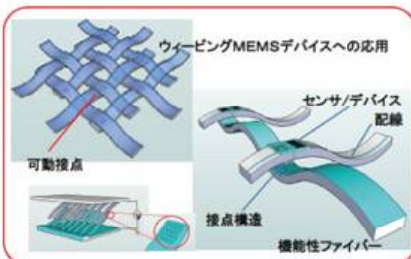
特許5245167
特開2011-073912



繊維状基材微細加工・集積

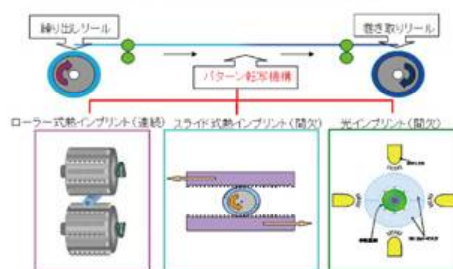
●繊維状基材の表面加工

特開2011-069030、特開12012-026064
未公開1件



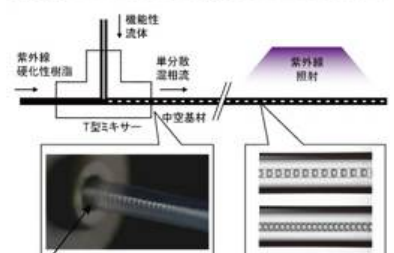
●繊維状基材の連続加工

○複合型RtoRインプリントシステム
特開2012-061817、未公開1件



○連続セル状構造形成
(マイクロ流路内気泡・液泡を利用する
微細構造生成プロセス)

特許5224395、特開2011-003831



●繊維状基材への連続成膜

未公開2件

